PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000-026774

(43) Date of publication of application: 25.01.2000

C09D 11/00 (51)Int.CI.

C09B 67/46 C09D 5/00 C09D 7/12

(21)Application number : **10-194710** (71)Applicant: MITSUI CHEMICALS INC

(22)Date of filing: (72)Inventor: OKUMA TADASHI 09.07.1998

KIYONO KAZUHIRO

OI TATSU

(54) ULTRAFINE PARTICULAR COLORING MATTER DISPERSION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject dispersion capable of providing a clear image having high transparency, and useful for an inkjet ink or the like by including a coloring matter obtained by dissolving the coloring matter hardly soluble in an aqueous solvent in a water-soluble polymer, and dispersing the dissolved coloring matter in the aqueous solvent, and having a particle diameter equal to or smaller than a prescribed value. SOLUTION: This dispersion is obtained by dissolving one or more coloring matters or the like having <0.1 wt.% solubility in an aqueous solvent and selected from the group of an azobased, an anthraquinone-based, a phthalocyanine-based, an olefin-based and a quinophthalone-based coloring matters in a water-soluble polymer such as polyvinylpyrrolidone, and dispersing the dissolved coloring matter or the like in the agueous solvent, and contains the coloring matter having ≤200 nm particle diameter and in an amount regulated so that the concentration of the coloring matter may be ≥0.1%. Preferably, an inkjet ink, an aqueous ink and an aqueous coating material are produced by using the ultrafine particular coloring matter dispersion.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許山東公開春号 特開2000-26774

(P2000-26774A)

(43)公開日 平成12年1月25日(2000.1.25)

(51) Int.CL*	織別配号	FI	デーマンート(参考)	
C0 9 D 11/00		CO9D 11/00	4 J O 3 8	
C 0 9 B 67/46		CO9B 67/46	B 4J039	
C 0 9 D 5/00		CO9D 5/00	Α	
7/12		7/12	A	
		審查請求 未請求	: 商求項の数6 OL (全 17 頁)	
(21)出顧番号	物顧平10−194710	(71)出廣人 000008	<u></u> 鱼麻人 000005887	
		三纬化	学株式会社	
(22)出顧日	平成10年7月9日(1998.7.9)	·	京京都千代田区假が関三丁目2番5号	
		(72) 発明者 大館	E	
			 県横浜市条区笠間町1190番地 三井	
		******	式会社内	
		(72) 発明者 清野		
			界横浜市条区空間町1190番地 三井	
		*****	京会社内	
		(72) 発明者 大井	·· ·	
			以横浜ff录区笠町町1190番地 三井	
		化学研	式会社内	
			最終質に続く	

(54) 【発明の名称】 超微粒子色素分像液

(57)【要約】

【解挟手段】 水系溶媒に対する溶解度が0.1重量% 未満である色素を水溶性高分子に溶解させた後、水系溶媒に分散させて得られる粒子径200nm以下の色素を含有する色素濃度0.1重量%以上の超微粒子色素分散液。

【効果】 極めて透明性が高く、インクジェットイン ク、水性インク、水性塗料として有用で、しかも、鮮明 な画像を形成することができる色素分散液を提供する。 (2)

【特許請求の節囲】

【請求項1】 水系溶媒に対する溶解度が(). 1重量% 未満である色素を水溶性高分子に溶解させた後、水系溶 媒に分散させて得られる粒子径200 nm以下の色素を 含有する色素濃度(). 1重量%以上の超級粒子色素分散

【請求項2】 色素がアゾ系、アントラキノン系、フタ ロシアニン系。オレフィン系およびキノフタロン系色素 からなる謎から選択される少なくとも一つの色素である 請求項1記載の色素分散液。

【請求項3】 色素を水溶性高分子に溶解させた後、水 系溶媒に分散させることを特徴とする調求項1または2 記載の色素分散液を製造する方法。

【請求項4】 請求項1または2記載の分散液を用いた インクジェットインク。

【請求項5】 請求項1または2記載の分散液を用いた 水性インク。

【請求項6】 請求項1または2記載の分散液を用いた 水性堡料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水系溶媒に難溶性 の色素を超微粒子として分散した色素分散液、ならびに その製造方法。および該分散液を用いたインクジェット インク、水性インク組成物、水性塗料に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェットインク、水性インク、水 性塗料の市場では、透明性の高い水性分散液で、かつ、 高い鮮明性を示す印刷画像が得られる水性分散液が求め 性の有機色素を用いて分散させる試みが行われており、 例として、特開昭61-283875号公報、特開昭6 4-6074号公報、特開平1-31881号公報、特 開昭55-80477号公報、特開昭58-13675 号公報、特關昭62-225577号公報、特願平1-213377号公銀などに記載の方法が知られている。

しかし、これらの方法では、色素粒子の経集により粒子 径が大きくなり、あるいは凝集抑制のため、予め粒子径 が大きな色素粒子を用いており、分散液の透明性が低 い。あるいは、インクジェットインクとして用いた際に は、噴射ノズルの目詰まりを招く等の問題がある。 【0003】また、インクジェットインクの分野では、 高画質化に伴ない質射ノズルの微細化が進んでおり、ノ ズルの目詰まり防止のため、粒子径200 nm以下のイ ンクが必要とされている。しかし、水系密媒による色素 10 分散液では、色素粒子の凝集抑制が難しく、その超微粒 子化は困難であった。特開平8-188722号公報に は、水に難溶な特定のアゾ系金属錯塩染料に限り、アミ ロース誘導体の6~8畳体で、分子量約1000~13 (1)の水溶性環状糖類であるシクロデキストリンを用 い、水溶性化させる方法が知られている。この方法で は、特定のアゾ系金属錯塩染料にのみシクロデキストリ ンの包接機能が発現、水溶性化を試みているが、一部の アゾ系金属錯塩染料やフタロシアニン染料については包 接していない。また、包接機能を有しない水溶性化合物 20 や、金属錯体を形成していないアゾ系色素やアントラキ ノン系、オレフィン系、キノフタロン系等の色素につい ては何ら記載されていない。

【りり04】分散染料や昇華転写記録用色素の分野で使 用される色素として、例えば、特別昭61-22709 2号公報等には下記一般式(1)(化1)のキノフタロ ン色素が、特開昭54-39437号公銀等には下記式 (2) (化1)のアントラキノン色素が、特別昭53-139880号公銀等には下記式(3)(化1)のアン トラキノン色素が記載され、比較的入手が容易な化合物 **られている。これらの分野においては、水系溶媒に離溶 30 である。しかし、インクジェットインク用色素として用** いる場合、従来公知の粉砕方法や微粒子形成方法では、 経集抑制しながら粒径200mm以下の色素粒子を形成 させることは難しい。

[0005]

[12]

(3)

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、鮮明 な印刷画像が得られる透明性の高い色素分散液、および その製造方法、該分散液を用いたインクジェットイン ク、水性イング、水性塗料を提供することである。 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を解決するため、鋭意検討した結果、水系溶媒に難溶 性の色素を、特殊な方法で超微粒子化することにより、 優れた性能を有する色素分散液が得られることを見出 し、本発明を完成するに到った。すなわち、本発明は、 ①水系密媒に対する溶解度が()、1重量%未満である色 素を水溶性高分子に溶解させた後、水系溶媒に分散させ 濃度). 1 重量%以上の超微粒子色素分散液に関するも のである。また、本発明は、〇色素がアゾ系、アントラ キノン系、フタロシアニン系、オレフィン系およびキノ フタロン系色素からなる群から選択される少なくとも一 つの色素である前記の記載の色素分散液、

◎色素を水溶性高分子に溶解させた後、水系溶媒に分散 させる前記のまたはのの色素分散液を製造する方法、 の前記のまたは②の分散液を用いたインクジェットイン ク、水性インク、水性塗料に関するものである。 [0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の超微粒子色素分散液は、水系溶媒に対し難溶性 の色素を水溶性高分子に溶解した後、水系溶媒と混合す ることによって得られるもので、従来技術の水系分散液 中の微粒子と比べて極めて粒子径が小さく、透明性に優 れた水系分散液であり、該分散液を利用して得られる印 即画像は極めて高い鮮明性を示すものである。

【①①①9】本発明の超散粒子色素分散液において、水 **浜溶媒とは、水と相溶性を有する溶媒であり、色素の溶** 解度が0.1重量%未満であり、且つ。水溶性高分子を「50」250,300、400、500;花王(株)製品エマ

①. 1重置%以上溶解させうるものであれば良い。具体 的には、水;メタノール。エタノール。プロパノール、 イソプロパノール、ブタノール、sec-ブタノール、 20 アミルアルコール、エチレングリコール、1,3-ブタ ンジオール、1、4-ブタンジオール、グリセリン等の アルコール系溶剤:アセトン、メチルエチルケトン、シ クロヘキサノン。メチルシクロヘキサノン等のケトン系 **密削;プチルアミン、シクロヘキシルアミン、アニリ** ン、エチレンジアミン、ビリジン、モルホリン、8-ア ミノエタノール、ジエタノールアミン、トリエタノール アミン、アミノエチルエタノールアミン等のアミン系容 剤などが挙げられる。

【①①10】水系溶媒の種類および使用量は、使用する て得られる粒子径200mm以下の色素を含有する色素 30 色素と水溶性高分子の組み合わせにより異なる。好まし い水系溶媒は、常圧における沸点が300℃以下のもの であり、特に好ましいのは、水である。また、その使用 置は、色素1重量部に対し、1~1000重置部、好ま しくは、5~100重量部である。

> 【0011】本発明の方法において、使用する水溶性高 分子は、使用する色素を1重置%以上、好ましくは10 重量%以上溶解する。また、水溶性高分子の平均分子費 は、通常1000以上、好ましくは5000以上であ る。さちに、本発明の方法において、使用する水溶性高 40 分子は、使用する水系溶媒に対し、0.1 宣置%以上、 好ましくは!重量%以上の溶解度を有する。

【①①12】本発明の超微粒子色素分散液において、使 用する水溶性高分子の例としては、ポリビニルビロリド ン〔インターナショナルスペシャリティープロダクツ (株) 製品PVPK-15、K-30、K-60、K-90、K-120等)、ポリピニルアルコール、ポリエ チレングリコール、ポリプロピレングリコール。ポリエ チレングリコールノニルフェニルエーテル [ライオン (株) 製品リボノックスNC140、150、200、

ルゲン906、912、916、920、985等1、 高級アルコール系〔ライオン(株)製品レオコールSC 200, 300, 400, レオックスLC150, TC -15()等)、ポリオキシアルキレングリコール系 (ラ イオン (株) 製品レオコン2400E、5050G 等) アルキルアミンEO付加物 (ライオン (株) 製品 エソミンHT/12, 14、17, 30等]、アルキル アミドEO付加物 [ライオン (株) 製品エマソイドHT /15. HT/60. O/15等〕等の非イオン型界面 活性剤、ナフトール/ホルマリン/亜磷酸ソーダの縮合 10 タノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノー 物。クレゾール/ホルマリン/亜硫酸ソーダの縮合物、 アルキル(またはフェニル)エーテル硫酸エステル塩、 アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等のアニオン系 界面活性剤、ポリ乳酸等のポリアミノ酸等が挙げられ、 これらをユニットとして含む共宣台高分子でもよい。 【0013】また、用いる水溶性高分子は、直鎖状のも のを用いるが、色素の溶解性や水への分散性を妨げなけ れば、分岐状のものを用いても襟わない。但し、鑑領 は、色素の溶解性、水系溶媒中での分散安定性が劣るこ とから好ましくない。これらの水溶性高分子は、単独 で、あるいは2種以上の混合物として用いることができ る。さらに、その他の添加剤として、エチレングリコー ル、グリセリン等の湿潤剤、防腐剤等を含有していても よい。その使用量は、色素 1 重置部に対し 1(1)()重置 部以下、好きしくは、0.1~100重置部である。 【①①14】本発明の超微粒子色素分散液は、具体的に は、(1) まず、水系溶媒に対する溶解度が()、1重置% 未満である色素を、水溶性高分子に溶解させ、(2) 次い で、得られた色素含有水溶性高分子を水系溶媒に添加 し、分散させる、方法により製造される。本発明の超微 30 300℃以下である有機溶剤である。 粒子色素分散液の製造方法において、色素を水溶性高分 子に溶解させる場合、色素、水溶性高分子の物性や形 状、あるいは作業性により異なるが、通常、水溶性高分 子の有機溶媒溶液に固体である色素を装入する。色素と 水溶性高分子の鉄入順序が逆であっても、また。同時に 装入しても構わない。すなわち、水溶性高分子を有機溶 削に溶解させ、次いで、色素を溶解させた後、有機溶媒 を留去する方法、あるいは、色素と水溶性高分子を同時 に添加して有機溶剤に溶解させた後、有級溶媒を留去す る方法等が用いられる。水溶性高分子あるいは色素が常 40 温で液体である場合には、この有機溶媒を使用すること **無く、頼り込み等の復合操作により溶解させてもよい。** 色素を水溶性高分子に溶解させる温度は、色素や水溶性 樹脂の安定性にもよるが、300℃以下である。好まし くは、0~250℃、更に好ましくは、20~200℃

【①①15】また、色素含有水溶性高分子の水系溶媒へ の続入方法は、通常、水系溶媒に色素含有水溶性高分子 を装入する。色素含有水溶性高分子の物性や形状、ある

である。

添加してもよい。添加温度は色素、水溶性高分子、水系 溶媒の安定性や水系溶媒の物性にもよるが、通常300 で以下、好ましくは0~200℃である。また、その分 敵は、微核的な捌拌等によって簡単に実施でき、捌拌速 度、捌拌機形状等に関係なく、粒子径200 nm以下の 色素粒子を含む分散液を得ることができる。

【①①16】この隙用いる有機溶媒としては、水溶性高 分子と色素の組み合わせにより異なるが、水溶性高分子 と色素を溶解させうるものが好ましい。具体的には、メ ル、プタノール、Sec‐ブタノール、アミルアルコー ル、エチレングリコール、1、3-ブタンジオール、 1、4-ブタンジオール、グリセリン等のアルコール系 溶剤: ベンゼン、トルエン、キシレン、アニソール、フ ェネトール、クロロベンゼン、トリフルオロメチルベン ゼン、ファ化ベンゼン、フェノール等の芳香族炭化水素 溶剤: ヘキサン、シクロヘキサン、ジクロロメタン、ク ロロボルム、ジクロロエタン、トリクロロエタン、パー クロロエチレン等の脂肪族炭化水素溶剤;アセトン、メ 20 チルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘ キサノン等のケトン系控制;ブチルアミン、シクロヘキ シルアミン、アニリン、エチレンジアミン、ピリジン、 モルポリン、2-アミノエタノール、ジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、アミノエチルエタノールア ミン等のアミン系溶剤:N、N-ジメチルホルムアミ ド、N、Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキ シド、スルホラン、1、3-ジメチル-2-イミダゾリ ジノン、ジメチルカーボネート等の非プロトン性極性疼 媒などが挙げられる。好ましくは、常圧における謝点が

【①①17】本発明の超微粒子色素分散液において、使 用される色素は、使用する水系溶媒に対する溶解度が ①. 1重量%未満で、かつ、水溶性高分子に①. 1重量 %以上、好ましくは、1重量%以上溶解するものであ る。その例として、下記一般式(4)(化2)で示され るアントラキノン系色素。

[0018]

[化2]

《式中、R、~R。は各々独立に、水素原子、ハロゲン 原子、ニトロ蟇、シアノ蟇、ヒドロキシ基、アミノ基、 置換または無置換アルキル基、置換または無置換アリー ル基、置換または無置換へテロ芳香族基、置換または無 置換アルコキン基、置換または無置換アリールオキシ 基、置換または無置換のアルキルチオ基、置換または無 いは作業性により、色素含有水溶性高分子に水系溶媒を 50 置換のアリールチオ基、置換または無置換のアルキルカ

ルボニル基、置換または無置換のアリールカルボニル基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換又は無置換のアルキルアミノカルボニル基、置換または無置換アルキルアミノ基、置換または無置換アルキルアミノ基、置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換のアルキルアリールアミノ基を表す。)

下記一般式 (5) (化3) で示されるキノフタロン系色 10 素

[0019]

[(£3]

$$\begin{array}{c} X_3 & X_2 \\ X_4 & X_4 \\ X_5 & X_7 \\ X_6 \end{array} \qquad (5)$$

(式中、X、~X、は各々独立に、水素原子、ハロゲン 原子、ニトロ墓、シアノ墓、ヒドロキシ基、アミノ基、 置換または無置換アルキル基、置換または無置換アリー ル基、置換または無置換ヘテロ芳香族基、置換または無 置換アルコキン基、置換または無置換アリールオキシ 基、置換または無置換のアルキルチオ基、置換または無 置換のアリールチオ基、置換または無置換のアルキルカ ルボニル基、固換または無置換のアリールカルボニル 基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換 または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換又は 30 **急置換のアルキルアミノカルボニル差。置換又は無置換** のアリールアミノカルボニル基、置換または無置換アル キルアミノ基、置換または無置換ジアルキルアミノ基、 置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換の ジアリールアミノ基、置換又は無置換のアルキルアリー ルアミノ基を表す。)

下記一般式 (6) (化4) で示されるフタロシアニン系 色素。

[0020]

【化4】

【式中、Y、~Y、6は各々独立に、水素原子、ハロゲ ン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ 基、置換または無置換アルキル基、置換または無置換ア リール基、置換または無置換へテロ芳香族基、置換また は無面換アルコキシ基、面換または無面換アリールオキ シ基、置換または無置換のアルキルチオ基、置換または **無置換のアリールチオ基、置換または無置換のアルキル** カルボニル基。置換または無置換のアリールカルボニル 基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換 または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換又は **急圏換のアルキルアミノカルボニル墓、畳換又は無畳換** のアリールアミノカルボニル基、置換または無置換アル キルアミノ基、置換または無置換ジアルキルアミノ基、 置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換の ジアリールアミノ基、置換又は無置換のアルキルアリー ルアミノ基を表し、Mは2個の水素原子、Fe Co、 Ni. Cu, Zn, Ru. Rh, Pd. Pt, AlX, SiX,、GeX,、SnX,(但し、Xは、F. C - 1. - Br、 1. ヒドロキン益、アルコキシ基、トリアル キルシリルオキシ基、トリアルキルゲルマニウムオキシ 基、トリアルキルスタニルオキシ基を表す。)を表 寸.)

下記一般式(7)(化5)で示されるオレフィン系色 素

[0021]

[(£5]

$$\begin{array}{cccc}
Z_1 & Z_2 & Z_3 \\
Z_2 & Z_4
\end{array} \tag{7}$$

(式中、2、~2、は各を独立に、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ墓、シアノ墓、ヒドロキン基、アミノ基、 置換または無置換アルキル墓、置換または無置換アリール墓、置換または無置換へテロ芳香族墓、置換または無 置換アルコキン墓、置換または無置換のリールオキシ 基、置換または無置換のアルキルチオ墓、置換または無 置換のアリールチオ基、置換または無置換のアルキルカ ルボニル基、置換または無置換のアリールカルボニル 基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換また または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換また (5)

10

急置換のアルキルアミノカルボニル基、置換又は無置換 のアリールアミノカルボニル基、置換または無置換アル キルアミノ基、置換または無置換ジアルキルアミノ基、 置換又は無置換のアリールアミノ基、置換又は無置換の ジアリールアミノ基、置換又は無置換のアルキルアリー ルアミノ基を表し、瞬り合う2個の基が一緒になりN-アルキルイミド華、Nーアリールイミド基、芳香頃、ヘ テロ芳香環を形成してもよい。)

9

下記一般式(8)で示されるアゾ系色素が挙げられる。 $D_1 - N = N - D_2$ (8)

(式中、D、 D) は、各々独立に置換または無置換ア リール基、置換または無置換へテロ芳香族基、活性メチ

レン量を表す。) 【0022】前記一般式(4)~(8)において、ハロ ゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、 ヨウ素原子が挙げられる。置換または無置換のアルキル 基は、炭素数1~20の直鎖、分岐又は環状のアルキル 基であり、例としては、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、イソプロピル基。カーブチル基、イソプチル チル苺、イソベンチル基、tegt-ベンチル蟇、se cーベンチル基、シクロベンチル基、nーヘキシル基、 1-メチルペンチル基、2-メチルベンチル基、3-メ チルペンチル墓。4-メチルペンチル墓、1,1-ジメ チルプチル基。1、2ージメチルプチル基、1、3ージ メチルプチル基、2、3-ジメチルプチル基、1、1、 2-トリメチルプロピル基、1,2、2-トリメチルプ ロビル基、1-エチルプチル基、2-エチルプチル基、 1-エチルー2-メチルプロピル基。 シクロヘキシル チルヘキシル墓。2-メチルヘキシル墓、3-メチルヘ キシル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル 基。1、1-ジメチルペンチル基、1、2-ジメチルペ ンチル基、1、3-ジメチルペンチル基、1,4-ジメ チルベンチル基。2、2-ジメチルベンチル基。2、3 - ジメチルペンチル基、2、4 - ジメチルペンチル基、 3、3-ジメチルペンチル基、3、4-ジメチルペンチ ル基。1-エチルペンチル基、2-エチルペンチル基、 3-エチルペンチル基、1、1,2-トリメチルプチル リメチルブチル幕、1、2、2-トリメチルブチル基、 1、3、3-トリメチルブテル基、2、3、3-トリメ チルプチル基。1-エチル-1-メチルブチル基。1-エチルー2ーメチルブチル基、1-エチルー3-メチル プチル基、2-エチルー1-メチルプチル基、2-エチ ルー3ーメチルプチル基。1-n-プロピルプチル基、 1-イソプロビルブチル基 1-イソプロビルー2-メ チルプロピル基。メチルシクロヘキシル基、n-オクチ ル基、1-メチルヘプチル基、2-メチルヘプチル基、 3-メチルヘブチル基、4-メチルヘブチル基。5-メ=50=ル基。3.5.5-トリメチルヘキシル基、n-デシル

チルヘプチル益。6-メチルヘプチル益、1、1-ジメ チルヘキシル基、1、2-ジメチルヘキシル基、1、3 ージメチルヘキシル基、1、4 ージメチルヘキシル基、 1.5-ジメチルヘキシル益、2,2-ジメチルヘキシ ル基 2、3-ジメチルヘキシル基 2、4-ジメチル ヘキシル基、2、5 - ジメチルヘキシル基、3、3 - ジ メチルヘキシル基、3,4-ジメチルヘキシル基、3, 5-ジメチルヘキシル基。4、4-ジメチルヘキシル 基。4、5ージメチルヘキシル基、1ーエチルヘキシル 16 基、2-エチルヘキシル基、3-エチルヘキシル基 4 ーエチルヘキシル基、

【①023】1-n-プロビルペンチル基、2-n-プ ロビルペンチル基、1-イソプロビルペンチル基。2-イソプロピルペンチル基。1-エチル-1-メチルペン チル基、1-エチル-2-メチルペンチル基、1-エチ ルー3-メチルペンチル苺、1-エチルー4-メチルペ ンチル基、2-エチルー1-メチルベンチル基。2-エ チルー2ーメチルペンチル基、2ーエチルー3ーメチル ペンチル基、2-エチル-4-メチルペンチル基、3-基. tert-ブチル基. sec-ブラル基、n-ペン 20 エチル-1-メチルペンチル基、3-エチル-2-メチ ルベンチル基。3-エチル-3-メチルベンチル基、3 ーエチルー4-メチルペンチル基、1、1,2-トリメ チルベンチル基。1、1、3-トリメチルベンチル基、 1、1,4-トリメチルペンチル基。1,2,2-トリ メチルペンチル墓、1、2、3-トリメチルペンチル 基、1,2,4-トリメチルペンチル基、1,3、4-トリメチルペンチル基、2、2、3-トリメチルペンチ ル基、2、2、4-トリメチルペンチル基、2、3、4 - トリメチルベンチル基。1、3、3 - トリメチルベン 巷」メチルシクロペンチル苺、n-ヘブチル巷、1-メ=30=チル苺、2,3.3-トリメチルペンチル巷、3.3. 4-トリメチルペンチル甚、1,4、4-トリメチルペ ンチル基、2、4、4-トリメチルペンチル基、3、 4、4-トリメチルペンチル基、1-m-ブチルプチル 基、1-イソプチルブチル蟇、1-sec-ブチルブチ ル基、1-tert-ブチルブチル基、2-tert-ブチルプチル基 1-n-プロピル-1-メチルプチル 基、1-n-プロピルー2-メチルブチル基、1-n-プロビルー3-メチルプチル基、1-イソプロビルー1 -メチルプチル基、1-イソプロピル-2-メチルプチ 基。1, 1, 3-トリメチルブチル基。1, 2, 3-ト 46 ル基。1-イソプロピル-3-メチルブチル基。1, 1 ージエチルプチル基、1、2-ジエチルプチル基、1-エチルー1,2-ジメチルプチル基。1-エチルー1, 3-ジメチルプチル基、1-エチル-2, 3-ジメチル ブチル基、2-エチルー1、1-ジメチルブチル基、2 -エチル-1、2-ジメチルプチル基、2-エチル-1、3-ジメチルプチル苺、2-エチル-2,3-ジメ チルプチル基。1,2-ジメチルシクロヘキシル基、 1. 3 - ジメチルシクロヘキシル基。1, 4 - ジメチル シクロヘキシル苺、エチルシクロヘキシル苺、n-ノニ (7)

11 基等の炭素数1~10の直鎖、分岐又は環状のアルキル

【0024】フルオロメチル基、トリフルオロメチル 基。クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメ チル基、プロモメチル基。ジプロモメチル基、トリプロ モメチル基、ブルオロエチル基、クロロエチル基。プロ モエチル基、トリフルオロエチル基。ペンタフルオロエ チル基、テトラクロロエチル基、ヘキサフルオロイソブ ロビル基等のハロゲン原子が1~21個置換した炭素数 1~10の直鎖、分岐又は環状のハロゲン化アルキル 基。メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシ メチル基、プトキシメチル基、ペントキシメチル基、へ キシルオキシメチル基、シクロヘキシルオキシメチル 基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシ エチル基、プトキシエチル基、ペントキシエチル基、ヘ キシルオキシエチル基、シクロヘキシルオキシエチル 基。メトキシエトキシエテル基、メトキシプロヒル基、 エトキシプロビル基、プロポキシプロビル基、プトキシ プロビル基、ペントキシプロビル基。ヘキシルオキシブ ロビル基、シクロヘキシルオキシプロビル基、メトキシ 20 ル基 6-メチルー1-ナフチル基 7-メチルー1-エトキシプロビル基等の炭素数1~10の直鎖。分岐又 は環状のアルコキシ基が置換したアルキル基、ヒドロキ シメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル 基等のヒドロキシ基が置換した炭素数1~10アルキル

【()()25】メチルチオメチル基、エチルチオメチル 基。プロピルチオメチル基。ブチルチオメチル基。ペン チルチオメチル墓、ヘキシルチオメチル基、シクロヘキ シルチオメチル墓、メチルチオエチル墓、エチルチオエ チル基、プロビルチオエチル基、プチルチオエチル基、 ペンチルチオエチル基、ヘキシルチオエチル基、シクロ ヘキシルチオエチル基、メトキシエチルチオエチル基。 メチルチオプロビル基、エチルチオプロビル基。プロビ ルチオプロピル基、ブチルチオプロピル基、ペンチルチ オプロピル基。ヘキシルチオプロピル基、シクロヘキシ ルチオプロピル基、メトキシエチルチオプロピル基等の 炭素敷1~10の直鎖、分岐又は環状のアルキルチオ基 が置換したアルキル基、N-メチルアミノメチル基、 N、N-ジメチルアミノメチル基、N-エチルアミノメ ルアミノメチル基、N、N-ジプロビルアミノメチル 基、NーヌチルーNーエチルアミノメチル基、Nーヌチ ルアミノエチル墓、N、N-ジメチルアミノエチル基、 N-エチルアミノエチル墓、N、N-ジエチルアミノエ チル基、N-プロピルアミノエチル基、N,N-ジプロ ピルアミノエチル基、N-メチル-N-エチルアミノエ チル基、N-メチルアミノブロビル基、N,N-ジメチ ルアミノプロビル基、N-エチルアミノプロビル幕。 N. N-ジェチルアミノプロピル基。N-プロピルアミ

12

N-エチル-N-ブチルアミノプロビル基等の炭素数1 ~10の直鎖、分岐又は環状のアルキルアミノ基又はジ アルキルアミノ墓が置換したアルキル墓が挙げられる。 【0026】置換又は無置換のアリール基の例として は、フェニル基、ナフチル基、アンスラニル基、2-メ チルフェニル墓、及び3-メチルフェニル基、4-メチ ルフェニル基、2、3ージメチルフェニル基、2、4-ジメチルフェニル基、2、5-ジメチルフェニル基、 2、6-ジメチルフェニル基、3、4-ジメチルフェニ 19 ル基、3、5 - ジメチルフェニル基、3、6 - ジメチル フェニル基、2、3,4-トリメチルフェニル基、2, 3、5-トリメチルフェニル基、2、3,6-トリメチ ルフェニル基、2、4、5-トリメチルフェニル量、 2、4,6-トリメチルフェニル基。3,4,5-トリ メチルフェニル基、2-エチルフェニル基、プロビルフ ェニル基、ブチルフェニル基、ヘキシルフェニル基、シ クロヘキシルフェニル基。オクチルフェニル基。2-メ チルー1ーナフチル基、3ーメチルー1ーナフチル基、 4-メチルー1-ナフチル基、5-メチルー1-ナフチ ナフタル基、8-メチル-1-ナフタル基、1-メチル -2-ナフチル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチルー2ーナフチル基、5ーメチルー2ーナフチル 基。6-メチル-2-ナフチル基、7-メチル-2-ナ フチル基、8-メチル-2-ナフチル基、2-エチル-1-ナフチル基等の炭素数1~10の直鎖、分岐又は環 状のアルキル基が置換したアリール基。

【0027】3-メトキンフェニル墓。4-メトキシフ ェニル基、2、3ージメトキシフェニル基、2、4ージ 30 メトキシフェニル基、2、5-ジメトキシフェニル基、 2、6-ジメトキシフェニル基、3、4-ジメトキシフ ェニル基、3、5ージメトキシフェニル基、3、6ージ メトキシフェニル基、2、3,4-トリメトキシフェニ ル墓、2、3、5-トリメトキシフェニル基、2、3、 6-トリメトキシフェニル墓、2,4、5-トリメトキ シフェニル基 2.4.6-トリストキシフェニル基。 3、4、5-トリメトキンフェニル墓。2-エトキシフ ェニル基、プロポキシフェニル基、ブトキシフェニル 基。 ヘキシルオキシフェニル基、シクロヘキシルオキシ チル基、N,N-ジエチルアミノメチル基、N-プロピ 40 フェニル基、オクチルオキシフェニル基、2-メトキシ -1-ナフチル基、3-メトキシー1-ナフチル基、4 ーメトキシー1ーナフチル基、5ーメトキシー1ーナフ チル基、6-メトキシー1-ナフチル基、7-メトキシ -1-ナフチル華、8-メトキシー1-ナフチル華、1 ーメトキシー2-ナフチル基、3-メトキシー2-ナフ チル蟇、4ーメトキシー2ーナフチル蟇、5ーメトキシ -2-ナフチル基、6-メトキシー2-ナフチル基、7 ーメトキシー2ーナフチル蟇、8ーメトキシー2ーナフ チル基、2-エトキシー1-ナフチル基等の炭素数1~ ノブロビル基 N, N-ジブロビルアミノプロビル基、 50 10の直鎖、分岐又は環状のアルコキシ基が置換したア

14

リール基、ヒドロキシフェニル基、ジヒドロキシフェニ ル基。トリヒドロキシフェニル基等のヒドロキシ基が置 換したアリール量、

13

【0028】クロロフェニル基、ジクロロフェニル基、 トリクロロフェニル基、プロモフェニル基、ジプロモフ ュニル基、ヨードフェニル基、フルオロフェニル基、ジ フルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基。テトラ フルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基等のハ ロゲン原子が置換したアリール基、トリフルオロメチル ル莓、N,N-ジメチルアミノフェニル基、N、N-ジ エチルアミノフェニル基、N-フェニル・N-メチルア ミノフェニル墓。N-トリル-N-エチルアミノフェニ ル基、N-クロロフェニル・N-シクロヘキシルアミノ フェニル基、N、N-ジトリルアミノフェニル基等のN ーモノ置換アミノ置換アリール基、N、N ージ置換アミ ノアリール基が挙げられ、他にメチルチオフェニル基、 エチルチオフェニル基、メチルチオナフチル基。フェニ ルチオフェニル芸等のアルキルチオアリール基。アリー ルチオアリール基等が挙げられる。

【①①29】置換または無置換のヘテロ芳香族基の例と しては、ピリジル基、メチルピリジル基、エチルピリジ ル基。クロロビリジル基。プロモビリジル基、ニトロビ リジル基、キノリル基、メチルキノリル基、エチルキノ リル基、クロロキノリル基。プロモキノリル基。ニトロ キノリル基、フリル基、メチルフリル基、エチルフリル 基。クロロフリル基、プロモフリル基。ニトロプリル 基。ピラニル基。メチルピラニル基。エチルピラニル。 基。クロロピラニル基、プロモピラニル基、ニトロピラ ローリル基、クロロピローリル基、プロモピローリル 基。ニトロピローリル基。イミダゾリル基、メチルイミ ダゾリル基、エチルイミダゾリル基、クロロイミダゾリ ル墓。プロモイミダゾリル墓。ニトロイミダゾリル基。 オキサゾリル墓。メチルオキサゾリル墓、エチルオキサ ゾリル基、クロロオキサゾリル基、プロモオキサゾリル 基。ニトロオキサゾリル基。ピラゾリル基、メチルピラ ゾリル基、エチルピラゾリル基、クロロピラゾリル基、 プロモピラゾリル基、ニトロピラゾリル基、チエニル 基。メチルチエニル基、エチルチエニル基、クロロチエ 40 【0031】アルコキシアルコキシアルコキシ墓。N-ニル基、プロモチエニル基。ニトロチエニル基。チアゾ リル基、メチルテアゾリル基、エチルチアゾリル基、ク ロロチアゾリル基、プロモチアゾリル基、ニトロチアゾ リル墓、イソチアゾリル墓、メチルイソチアゾリル基、 エチルイソチアゾリル基。クロロイソチアゾリル基。ブ ロモイソチアゾリル基、ニトロイソチアゾリル基、イソ キザゾリル基。メチルイソキザゾリル基、エチルイソキ ザゾリル基、クロロイソキザゾリル基、プロモイソキザ ゾリル基、ニトロイソキザゾリル基。ビリミジル基、メ

ジル基、プロモビリミジル基、ニトロビリミジル基等が

【0030】置換又は無置換アルコキシ基の例として は、メトキシ墓、エトキシ墓、プロボキシ基、プトキシ 基。ペントキシ墓、1-メタルプトキシ基、2-メチル ブトキシ基、3-メチルブトキシ基、1,1-ジメチル プトキシ基、1、2ーシメチルプトキシ基、2、2ージ メチルプトキン量、1-エチルプロポキシ基、2-エチ ルプロポキシ基。ヘキシルオキシ基。シクロヘキシルオ フェニル基等のハロゲン化アルキル基が置換したアリー 10 キン基、ヘプチルオキシ基。メチルシクロヘキシルオキ シ苗、オクチルオキシ苺、エチルシクロヘキシル苺、ジ メチルシクロヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、3、5、5-トリメチルヘキ シルオキシ基。デシルオキシ基等の直鎖、分岐または環 状の炭素数!~10のアルコキシ基。フルオロメトキシ 基。トリフルオロメトキシ基、フルオロエトキシ基、ト リプルオロエトキシ基、ヘキサフルオロエトキシ基、フ ルオロプロポキシ基、トリフルオロプロポキシ基、ヘキ サフルオロプロポキシ基。クロロメトキシ基、トリクロ 20 ロメトキシ基。クロロエトキシ基、トリクロロエトキシ 基等のハロゲン原子が1~21個置換した直鎖。 分岐ま たは環状の炭素数1~10のハロゲン化アルコキシ基、 メトキシメトキシ基、エトキシメトキシ基、プロポキシ メトキシ基、プトキシメトキシ基、シクロヘキシルオキ シメトキシ基、メトキシメトキシメトキシ基、メトキシ エトキシ基、エトキシエトキシ基、プロポキシエトキシ 基。プトキシエトキシ基。シクロヘキシルオキシエトキ シ蟇、メトキシエトキシエトキシ基、エトキシエトキシ エトキシ基、プロポキシエトキシエトキシ基、ブトキシ ニル苺、ピローリル苺、メタルピローリル苺、エタルピ 30 エトキシエトキシ苺、メトキシメチルエトキシ苺。エト キシメチルエトキシ基、プロポキシメチルエトキシ基、 プトキシメチルエトキシ基。シクロヘキシルオキシメチ ルエトキシ基。メトキシエトキシメチルエトキシ基。エ トキシエトキシメチルエトキシ基、プロポキシエトキシ メチルエトキン基、プトキシエトキシメチルエトキシ 基、2-[(2)-メトキシ)プロポキシ]プロポキシ 基。メトキシプロポキシ基。エトキシプロポキシ基、エ トキンプロポキン基等の直鎖、分岐または環状の炭素数 1~10のアルコキシアルコキシ基。

メチルアミノメトキシ基、N, N-ジメチルアミノメト キン基、N-エチルアミノメトキシ基、N、N-ジエチ ルアミノメトキシ基、N-メチルアミノエトキシ基、 N. N-ジメチルアミノエトキシ基. N-エチルアミノ エトキシ基、N、Nージエチルアミノエトキシ基、Nー メチルアミノブロボキシ墓、N、N-ジブチルアミノブ ロボキシ基、N-メチルアミノブトキシ基等の直鎖、分 **岐または環状の炭素数1~10のアルキルアミノアルコ** キン芸、メチルチオメトキン基、エチルチオメトキシ チルビリミジル芸、エチルビリミジル芸、クロロビリミ 50 基。プロピルチオメトキン芸、メチルチオエトキン芸、

エチルチオエトキシ基、プロピルチオエトキシ基等の直 鎖、分岐または原状の炭素数1~10のアルキルチオア ルコキシ基、フェノキシエトキシ基、ナフチルオキシエ トキシ基、トリルオキシエトキシ基。エチルフェノキシ エトキシ基等のアリールオキシアルコキシ基が挙げられ

15

【① 032】置換又は無置換アリールオキシ基の倒とし ては、フェニルオキシ基、ナフチルオキシ基、アンスラ ニルオキシ基、2ーメチルフェニルオキシ基、及び3-メチルフェニルオキシ基。4-メチルフェニルオキシ 基。2、3ージメチルフェニルオキシ基、2、4ージメ チルフェニルオキシ基、2、5-ジメチルフェニルオキ シ蟇、2、6-ジメチルフェニルオキシ基、3、4-ジ メチルフェニルオキシ基。3、5 - ジメチルフェニルオ キシ墓、3、6-ジメチルフェニルオキシ基、2、3、 4-トリメチルフェニルオキシ基、2、3,5-トリメ チルフェニルオキシ基、2、3、6-トリメチルフェニ ルオキシ基、2、4、5-トリメチルフェニルオキシ 基、2、4、6-トリメチルフェニルオキシ基、3、 ニルオキシ基。プロピルフェニルオキシ基、ブチルフェ ニルオキシ基。ヘキシルフェニルオキシ基、シクロヘキ シルフェニルオキシ基、オクチルフェニルオキシ基、2 ーメチルー1ーナフチルオキシ基、3ーメチルー1ーナ フチルオキシ華、4-メチル-1-ナフチルオキシ基、 5-メチル-1-ナフチルオキシ基、6-メチル-1-ナフチルオキン基、7ーメチルー1ーナフチルオキシ 基、8-メチル-1-ナフチルオキシ基、1-メチル-2-ナフチルオキシ基、3-メチル-2-ナフチルオキ -2-ナフチルオキシ基、6-メチル-2-ナフチルオ キシ基、7-メチルー2-ナフチルオキシ基、8-メチ ルー2ーナフタルオキシ墓、2ーエチルー1ーナフチル オキン基等の炭素数1~10の直鎖、分岐又は環状のア ルキル基が置換したアリールオキシ基。

【0033】3-メトキシフェニルオキシ基、4-メト キシフェニルオキシ基、2、3-ジメトキシフェニルオ キン墓、2,4-ジメトキシフェニルオキシ基、2,5 ージメトキシフェニルオキシ基、2、6-ジメトキシフ ェニルオキシ基、3、4-ジメトキシフェニルオキシ 基、3、5ージメトキシフェニルオキン基、3、6ージ メトキシフェニルオキシ墓、2、3、4-トリメトキシ フェニルオキン苺、2,3、5-トリメトキシフェニル オキシ基、2、3、6-トリメトキシフェニルオキシ 基、2、4、6-トリメトキシフェニルオキシ基、2、 4. 6-トリメトキシフェニルオキン量、3. 4. 5-トリメトキシフェニルオキン基、2-エトキシフェニル オキシ基、プロポキシフェニルオキシ基、ブトキシフェ ニルオキシ基、ヘキシルオキシフェニルオキシ基、シク

ュニルオキシ墓、2-3トキシー1-ナフチルオキシ 基、3-メトキシー1-ナフチルオキシ基、4-メトキ シー】ーナフチルオキシ墓、5ーメトキシー】ーナフチ ルオキシ基、6-メトキシー1-ナフチルオキシ基、7 ーメトキシー1ーナフチルオキシ基、8ーメトキシー1 ーナフチルオキン基、1-メトキシ-2-ナフチルオキ シ基、3-メトキシー2-ナフチルオキシ基、4-メト キシー2ーナフチルオキン基、5ーメトキシー2ーナフ チルオキシ基、6-メトキシ-2-ナフチルオキシ基、 10 7-メトキシー2-ナフチルオキシ芸、8-メトキシー 2-ナフチルオキシ基、2-エトキシ-1-ナフチルオ キン基等の炭素数1~10の直鎖、分岐又は環状のアル

コキシ基が置換したアリールオキシ基。

16

【①034】クロロフェニルオキシ蟇、ジクロロフェニ ルオキシ基、トリクロロフェニルオキシ基、プロモフェ ニルオキシ基。ジブロモフェニルオキシ基、ヨードフェ ニルオキシ基。フルオロフェニルオキシ基、ジフルオロ フェニルオキシ墓、トリフルオロフェニルオキシ墓、テ トラフルオロフェニルオキシ基、ペンタフルオロフェニ 4. 5-トリメチルフェニルオキシ基。2-エチルフェ 20 ルオキシ基等のハロゲン原子が置換したアリールオキシ 基。トリフルオロメチルフェニルオキシ基等のハロゲン 化アルキル基が置換したアリールオキシ基、N、N - ジ メチルアミノフェニルオキシ基、N、N-ジエチルアミ ノフェニルオキシ基、N-フェニル-N-メチルアミノ フェニルオキシ蟇、N-トリル-N-エチルアミノフェ ニルオキシ基、N-クロロフェニル-N-シクロヘキシ ルアミノフェニルオキシ墓、N, N-ジトリルアミノフ ェニルオキシ基等のN-モノ置換アミノアリールオキシ 基、N、N - ジ置換アミノアリールオキシ基、メチルチ シ墓、4 - メチルー2ーナフチルオキシ基、5 - メチル(30)オフェニルオキシ基、エチルチオフェニルオキシ墓、メ チルチオナフチルオキシ基。シクロヘキシルチオフェニ ルオキシ基等のアルキルチオアリールオキシ基。フェニ ルチオフェニルオキシ基。ナフチルチオフェニルオキシ 基。フェニルチオナフチルオキシ基等のアリールチオア リールオキシ基等が挙げられる。

【①①35】置換または無置換のアルキルチオ基の例と しては、メチルチオ基、エチルチオ基、カープロビルチ オ墓、イソプロビルチオ墓、カーブチルチオ基、イソブ チルチオ基、Sec-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ 46 基、1-メチルプチルチオ基、2-メチルプチルチオ 基。3-メチルブチルチオ基、1,1-ジメチルブチル チオ基、1、2-ジメチルプチルチオ基、2、2-ジメ チルプチルチオ墓、1-エチルプロピルチオ基、2-エ チルプロピルチオ基、n-ヘキシルチオ基、シクロヘキ シルチオ基、n-ヘプチルチオ基、メチルシクロヘキシ ルチオ基、n-オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチ オ芸、エチルンクロヘキンルチオ基、ジメチルンクロヘ キシルチオ基。n-ノニルチオ基、3、5、5-トリメ チルヘキシルチオ基、n-デシルチオ基等の炭素数1~ ロヘキシルオキンフェニルオキシ基。オクチルオキシフ 50 10の直鎖、分岐または環状のアルキルチオ基。メトキ (10)

18

シメタルチオ基。エトキシメチルチオ基、メトキシエチ ルチオ基、エトキシエチルチオ基、nープロポキシエチ ルチオ基、イソプロポキシエチルチオ基、カープトキシ エチルチオ基。イソプトキシエチルチオ基、tert-ブトキシエチルチオ基、11-ヘキシルオキシエチルチオ 基。シクロヘキシルオキシエチルチオ基、2-メトキシ プロビルチオ基。メトキシイソプロビルチオ基。2-エ トキンプロピルタオ基、エトキシイソプロピルタオ基、 2-プロポキシブロピルチオ基、プロポキシイソブロピ アルコキシアルキルチオ墓。

17

【()()36】メチルチオメチルチオ蟇、エチルチオメチ ルチオ基、メチルチオエチルチオ基、エチルチオエチル チオ基、nープロピルチオエチルチオ基、イソプロピル チオエチルチオ墓、nープチルチオエチルチオ墓。イソ ブテルチオエチルチオ基。tert- ブチルチオエチル チオ基、n-ヘキシルチオエチルチオ基、シクロヘキシ ルチオエチルチオ基、2-メチルチオプロピルチオ基、 メチルチオイソプロビルチオ基、2-エチルチオプロビ ルチオプロピルチオ基、プロピルチオイソプロビルチオ 基、メチルチオエトキシエチルチオ基、エチルチオエチ ルチオエチルチオ基等の炭素数1~10の直鎖、分岐ま たは環状のアルキルチオアルキルチオ基、Nーメチルア ミノメチルチオ墓、N-メチルアミノエチルチオ墓、N ーエチルアミノメチルチオ墓、Nーエチルアミノエチル チオ墓、N、Nージメチルアミノメチルチオ基、N、N -ジエチルアミノメチルチオ基、N、N-ジメチルアミ ノエチルチオ墓(N.N-ジエチルアミノエチルチオ基) キルアミノアルキルチオ蟇、N、N-ジアルキルアミノ アルキルチオ基等を挙げることができる。

【0037】置換又は無置換アリールチオ基としては、 例として、フェニルチオ基、トリルチオ基、クロロフェ ニルチオ基、トリフルオロフェニルチオ基、ナフチルチ オ基、メチルナフチルチオ基、クロロナフチルチオ基等。 が挙げられる。置換または無置換のアルキルカルボニル 基の倒としては、メチルカルボニル基。エチルカルボニ ル墓。n-プロビルカルボニル基、イソプロピルカルボ ル基、Sec-ブチルカルボニル基、n-ペンチルカル ボニル基、ユーメチルブチルカルボニル基、2-メチル ブチルカルボニル基、3-メチルブチルカルボニル基、 1. 1-ジメチルブチルカルボニル基. 1. 2-ジメチ ルプチルカルボニル基、2、2-ジメチルブチルカルボ ニル基、1-エチルプロピルカルボニル基、2-エチル プロビルカルボニル基、n-ヘキシルカルボニル基、シ クロヘキシルカルボニル芸。n-ヘプチルカルボニル 基。メチルシクロヘキシルカルポニル基、n-オクチル カルボニル基。2-エチルヘキシルカルボニル基。エチ 50 基の倒としては、メトキシカルボニル基、エトキシカル

ルシクロヘキシルカルボニル基、ジメチルシクロヘキシ ルカルボニル基。n-ノニルカルボニル基、3、5,5 ートリメチルヘキシルカルボニル基。n-デシルカルボ ニル基等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のア ルキルカルボニル基、

【0038】メトキシメチルカルボニル基、エトキシメ チルカルボニル蟇、メトキシエチルカルボニル蟇。エト キシエチルカルボニル基。n-プロポキシエチルカルボ ニル基、イソプロボキシエチルカルボニル基、n-ブト ルチオ基等の炭素数1~10の直鎖 分娩または環状の 10 キシエチルカルボニル基 イソプトキシエチルカルボニ ル基。tegt-ブトキシエチルカルポニル基。n-ヘ キシルオキシエチルカルボニル基、シクロヘキシルオキ シエチルカルボニル基、2-メトキンプロピルカルボニ ル芸、メトキシイソプロビルカルボニル基、2-エトキ シブロピルカルボニル基。エトキシイソプロピルカルボ ニル芸、2ープロポキシプロピルカルポニル基、プロポ キシイソプロビルカルボニル基等の炭素数1~10の直 鎖、分岐または環状のアルコキシアルキルカルボニル 基、メチルチオメチルカルボニル基、エチルチオメチル ルチオ基、エチルチオイソプロビルチオ基、2 - プロビ 20 カルボニル基 メチルチオエチルカルボニル基 エチル チオエチルカルボニル基。n-プロビルチオエチルカル ボニル基、イソプロピルチオエチルカルボニル基。n-プチルチオエチルカルボニル基、イソプチルチオエチル カルボニル基。tert‐ブチルチオエチルカルボニル 基、ガーヘキシルチオエチルカルボニル基、シクロヘキ シルチオエチルカルボニル墓、2-メチルチオプロピル カルボニル基。メチルチオイソフロビルカルボニル基、 2-エチルチオプロピルカルボニル基。エチルチオイソ プロビルカルボニル基、2-プロピルチオプロビルカル 等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のN-アル 30 ボニル基、プロビルチオイソプロビルカルボニル基、メ チルチオエトキシエチルカルボニル莓。エチルチオエチ ルチオエチルカルボニル基等の炭素数1~10の直鎖。 分岐または環状のアルキルチオアルキルカルボニル基、 N-メチルアミノメチルカルボニル墓。N-メチルアミ ノエチルカルボニル基、N-エチルアミノメチルカルボ ニル基、N-エチルアミノエチルカルボニル基、N、N ージメチルアミフメチルカルボニル墓。N,N‐ジエチ ルアミノメチルカルボニル墓、N、N-ジメチルアミノ エチルカルポニル基、N、N-ジエチルアミノエチルカ ニル基、n-ブチルカルボニル基、イソブチルカルボニ 40 ルボニル基等の炭素数 1~10 の直鎖、分岐または環状 のN-アルキルアミノアルキルカルボニル基、N、N-ジアルキルアミノアルキルカルボニル基等を挙げること

> 【0039】置換又は無置換アリールカルボニル基とし ては、例として、フェニルカルボニル墓、トリルカルボ ニル基、クロロフェニルカルボニル基、トリフルオロフ ェニルカルボニル基、ナフテルカルボニル基、メチルナ フチルカルボニル基、クロロナフチルカルボニル基等が 挙げられる。置換または無置換のアルコキシカルボニル

22

?1 ルチオメチルアミノカルボニル基、メチルチオエチルア ミノカルボニル墓、エチルチオエチルアミノカルボニル 基。カープロビルチオエチルアミノカルボニル基。イソ プロビルチオエチルアミノカルボニル基、n-プチルチ オエタルアミノカルボニル基、イソプチルチオエチルア ミノカルボニル墓、tert-ブチルチオエチルアミノ カルボニル基。nーヘキシルチオエチルアミノカルボニ ル基。シクロヘキシルチオエチルアミノカルポニル基、 2-メチルチオプロピルアミノカルボニル基、メチルチ オイソプロピルアミノカルボニル基。2-エチルチオブ 15 ミノ基等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のア ロビルアミノカルボニル基。エチルチオイソプロビルア ミノカルボニル芸、2-プロピルチオプロピルアミノカ ルポニル基、プロピルチオイソプロピルアミノカルポニ ル基、メチルチオエトキシエチルアミノカルボニル基、 エチルチオエチルチオエチルアミノカルボニル基等の炭 素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキルチオア ルキルアミノカルボニル墓、N-メチルアミノメチルア ミノカルボニル基、N-メチルアミノエチルアミノカル ポニル基、N-エチルアミノメチルアミノカルボニル 基。N-エチルアミノエチルアミノカルボニル基。N, N-ジメチルアミノメチルアミノカルボニル基、N、N -ジエチルアミノメチルアミノカルボニル基、N、N-ジメチルアミノエチルアミノカルボニル基、N、Nージ エチルアミノエチルアミノカルボニル芸等の炭素数1~ 10の直鎖、分岐または環状のN-アルキルアミノアル キルアミノカルボニル基、N、N-ジアルキルアミノア ルキルアミノカルボニル基等を挙げることができる。 【0043】置換又は無置換アリールアミノカルボニル 基としては、例として、フェニルアミノカルボニル基、 トリルアミノカルボニル墓。クロロフェニルアミノカル 36 ミノエチルアミノ基、N、N-ジェチルアミノエチルア ボニル基、トリフルオロフェニルアミノカルボニル基、 ナフチルアミノカルボニル基、メチルナフチルアミノカ ルボニル基、クロロナフをルアミノカルボニル基等が挙 けられる。置換又は無置換N-アルキルアミノ基の例と しては、メチルアミノ基。エチルアミノ基、n-プロピ ルアミノ基、イソプロピルアミノ基。カーブチルアミノ 基、イソプチルアミノ基、sec-ブチルアミノ基、n ーペンチルアミノ基、1-メチルブチルアミノ基、2-メチルプチルアミノ基、3-メチルプチルアミノ基、 1. 1 - ジメチルプチルアミノ基、1、2 - ジメチルブ 46 ノ蟇、N、N - ジ(n - ペンチル)アミノ基、N、N -チルアミノ基、2、2-ジメチルブチルアミノ基、1-エチルプロピルアミノ基。2-エチルプロピルアミノ 基。nーヘキンルアミノ墓。シクロヘキシルアミノ基、 n-ヘプチルアミノ基、メチルシクロヘキシルアミノ 基、n-オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ 基。エチルシクロヘキシルアミノ基。ジメチルシクロヘ キシルアミノ墓。n-ノニルアミノ墓。3,5.5-ト リメチルヘキシルアミノ苺、n-デシルアミノ基等の炭 素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキルアミノ 基、メトキシメチルアミノ基、エトキシメチルアミノ 50 N. Nージ (メチルシクロヘキシル) アミノ基、N、N

基。メトキシエチルアミノ基、エトキシエチルアミノ 基。n-プロポキシエチルアミノ基。イソプロポキシエ チルアミノ基。nープトキシエチルアミノ基、イソプト キシエチルアミノ基、teェt-ブトキシエチルアミノ 基。n-ヘキシルオキシエチルアミノ基、シクロヘキシ ルオキシエチルアミノ基、2-メトキシプロピルアミノ 基、メトキシイソプロピルアミノ基、2-エトキシプロ ピルアミノ基。エトキシイソプロピルアミノ基。2-プ ロボキシプロビルアミノ基。プロボキシイソプロビルア ルコキシアルキルアミノ墓。 【①①44】メチルチオメチルアミノ蟇、エチルチオメ チルアミノ基、メチルチオエチルアミノ基、エチルチオ エチルアミノ基。n-プロビルチオエチルアミノ基、イ ソプロピルチオエチルアミノ基、n-プチルチオエチル アミノ基、イソプチルチオエチルアミノ基、tert-ブチルチオエチルアミノ基。 n - ヘキシルチオエチルア ミノ墓、シクロヘキシルチオエチルアミノ基、2-メチ ルチオプロピルアミノ基。メチルチオイソプロピルアミ 20 ノ岳、2-エチルチオプロビルアミノ岳、エチルチオイ ソプロピルアミノ基、2-プロピルチオプロピルアミノ 基。プロピルチオイソプロビルアミノ基、メチルチオエ トキシエチルアミノ基、エチルチオエチルチオエチルア ミノ基等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のア ルキルチオアルキルアミノ基、N-メチルアミノメチル アミノ基、N-メチルアミノエチルアミノ基、N-エチ ルアミノメチルアミノ基、N-エチルアミノエチルアミ ノ基、N、N-ジメチルアミノメチルアミノ基、N、N ージエチルアミノメチルアミノ基、N、N - ジメチルア ミノ基等の炭素数!~10の直鎖、分岐または環状のN ーアルキルアミノアルキルアミノ基、N、N - ジアルキ ルアミノアルキルアミノ基等を挙げることができる。 【0045】置換又は無置換のN、N-ジアルキルアミ ノ墓としては、例としてN、N-ジメチルアミノ墓、 N、Nージエチルアミノ基、N、Nージ(nープロピ ル) アミノ基、N、N-ジ (イソプロビル) アミノ基、 N、N - ジ (g - ブチル) アミノ基、N、N - ジ (イソ ブチル) アミノ墓、N, N-ジ (sec-ブチル) アミ ジ () - メチルプチル) アミノ基、N、N - ジ (2 - メ チルプチル〉アミノ基、N、Nージ(3ーメチルプチ ル) アミノ基、N、N-ジ(1、1-ジメチルプチル) アミノ基、N、N-ジ(1、2-ジメチルブチル)アミ ノ基、N, N-ジ (2, 2-ジメチルブチル) アミノ 基、N、Nージ(lーエチルプロピル)アミノ蟇、N、 N-ジ(2-エチルプロビル)アミノ基、N, N-ジ (n-ヘキシル) アミノ甚、N、N-ジ (シクロヘキシ ル) アミノ基、N、N-ジ (n-ヘプチル) アミノ基、

(11)

ボニル基、n‐プロポキシカルボニル基、イソプロポキ シカルボニル基。n-ブトキシカルボニル基、イソブト キシカルボニル基、sec‐ブトキシカルボニル基、n -ペントキシカルボニル蟇。1-メチルプトキシカルボ ニル基、2-メチルプトキシカルボニル基、3-メチル プトキシカルボニル基、1、1-ジメチルプトキシカル ボニル基、1、2-ジメチルプトキシカルボニル基、 2、2-ジメチルプトキンカルボニル墓、1-エチルプ ロボキシカルボニル基、2-エチルプロボキシカルボニ ルオキシカルボニル基、n-ヘプトキシカルボニル基、 メチルシクロヘキシルオキシカルボニル基、n-オクチ ルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシルオキシカル ボニル基、エチルシクロヘキシルオキシカルボニル基、 ジメチルシクロヘキシルオキシカルボニル基、n-ノニ ルオキシカルボニル基、3、5、5-トリメチルヘキシ ルオキシカルボニル基、n-デシルオキシカルボニル基 等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキ シカルボニル芸

19

エトキシカルボニル基、n-プロボキシエトキシカルボ ニル基、インプロポキシエトキシカルポニル基。n-ブ トキシエトキシカルボニル基、イソプトキシエトキシカ ルボニル基、te:t-ブトキシエトキシカルボニル 基、n-ヘキンルオキシエトキシカルボニル基、シクロ ヘキシルオキシエトキシカルボニル基。2-メトキシブ ロビルオキシカルボニル基。メトキシイソプロボキシカ ルボニル基、2-エトキシブロボキシカルボニル基、エ トキンイソプロポキシカルボニル基。2-プロポキシブ ボニル基等の炭素数1~10の直鎖 分岐または環状の アルコキシアルコキシカルボニル基。メチルチオエトキ シカルボニル墓。エチルチオエトキシカルボニル墓、n - プロピルチオエトキシカルボニル基。イソプロビルチ オエトキシカルボニル基。カープチルチオエトキシカル ボニル基、イソプチルチオエトキシカルボニル基。te r t - ブチルチオエトキシカルボニル墓、n - ヘキシル チオエトキシカルボニル墓。シクロヘキシルチオエトキ シカルボニル基 2-メチルチオプロポキシカルボニル 基。メチルチオイソプロポキシカルボニル基、2-エチ ルチオプロポキシカルボニル基。エチルチオイソプロボ キシカルボニル基、2-プロピルチオプロボキシカルボ ニル幕、プロビルチオイソプロポキシカルボニル幕、メ チルチオエトキシエトキシカルポニル墓、エチルチオエ チルチオエトキシカルボニル基等の炭素数1~10の直 鎖、分岐または環状のアルキルチオアルコキシカルボニ ル盐、Nーメチルアミノメトキシカルボニル基、Nーメ チルアミノエトキシカルボニル基、N-エチルアミノメ トキンカルボニル基、N-エチルアミノエトキシカルボ ニル基、N、Nージメチルアミノメトキシカルボニル

基。N、Nージエチルアミノメトキシカルボニル基、 N. N-ジメチルアミノエトキシカルボニル基 N. N - ジエチルアミノエトキシカルボニル芸等の炭素数1~ 10の直鎖、分岐または環状のN-アルキルアミノアル コキシカルボニル基、N、N-ジアルキルアミノアルコ キシカルボニル基等を挙げることができる。

【①①41】 置換又は無置換アリールオキシカルボニル 基としては、例として、フェノキシカルボニル墓。トリ ルオキシカルボニル基、クロロフェノキシカルボニル ル墓、n-ヘキシルオキンカルボニル墓、シクロヘキシ 16 基。トリフルオロフェノキシカルボニル基、ナフトキシ カルボニル基。メチルナフトキシカルボニル基。クロロ ナフトキシカルボニル基等が挙げられる。置換または無 置換のアルキルアミノカルボニル基の倒としては、メチ ルアミノカルボニル基、エチルアミノカルボニル基、n プロピルアミノカルボニル基、イソプロピルアミノカ ルボニル基、n-ブチルアミノカルボニル基、イソブチ ルアミノカルボニル基、Sec‐ブチルアミノカルボニ ル基。nーペンチルアミノカルポニル基、1-メチルブ チルアミノカルボニル基。2-メチルブチルアミノカル 【0040】メトキシエトキシカルボニル基、エトキシ 26 ボニル基、3-メチルプチルアミノカルボニル基、1, 1-ジメチルプチルアミノカルボニル墓、1、2-ジメ チルプチルアミノカルボニル基、2、2-ジメチルプチ ルアミノカルボニル基、1-エチルプロピルアミノカル ボニル基、2-エチルプロピルアミノカルボニル基、n - ヘキシルアミノカルボニル基、シクロヘキシルアミノ カルボニル基。n-ヘプチルアミノカルボニル墓。メチ ルシクロヘキシルアミノカルボニル基。n-オクチルア ミノカルボニル基、2-エチルヘキシルアミノカルボニ ル基。エチルンクロヘキシルアミノカルボニル基。ジメ ロボキシカルボニル基、プロボキシイソプロボキシカル 30 チルシクロヘキシルアミノカルボニル基、n-ノニルア ミノカルボニル基、3、5、5ートリメチルヘキシルア ミノカルボニル基、n-デシルアミノカルボニル基等の 炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキルアミ ノカルボニル墓。

【①042】メトキシメチルアミノカルボニル墓。エト キシメチルアミノカルボニル基、メトキシエチルアミノ カルボニル基。エトキシエチルアミノカルボニル基。n ープロポキシエチルアミノカルボニル基、イソプロポキ シエチルアミノカルボニル基、n-ブトキシエチルアミ 46 ノカルボニル蟇 イソプトキシエチルアミノカルボニル 基。tert-ブトキシエチルアミノカルボニル基、n - ヘキシルオキシエチルアミノカルボニル基、シクロヘ キシルオキシエチルアミノカルボニル基、2-メトキシ プロビルアミノカルボニル蟇、メトキシイソプロビルア ミノカルボニル墓、2-エトキシプロピルアミノカルボ ニル基、エトキシイソプロビルアミノカルボニル基、2 - プロポキシプロピルアミノカルポニル基、プロポキシ イソプロピルアミノカルボニル基等の炭素数1~10の 直鎖、分岐または環状のアルコキシアルキルアミノカル 50 ボニル基、メデルチオメデルアミノカルボニル墓。エチ

74

ージ (nーオクチル) アミノ基、N、Nージ (2ーエチ ルヘキシル) アミノ基、N、N - ジ (ジメチルシクロヘ キシル) アミノ墓、N、N - ジ(n - ノニル)アミノ 基、N、N-ジ(3、5、5-トリメチルヘキシル)ア ミノ墓、N, N-ジ (n-デシル) アミノ基、N-メチ ルーN-エチルアミノ基 N-プロピルーN-エチルア ミノ苺、N-ヘキシル-N-エチルアミノ基、N-オク チル-N-エチルアミノ墓、N- (シクロヘキンル) -N-エチルアミノ基等の炭素数1~10の直鎖、分岐ま たは環状のアルキルジ置換アミノ基。

23

【0046】N、Nージ (メトキシメチル) アミノ基、 N、N-ジ(エトキシメチル)アミノ墓、N,N-ジ (メトキシエチル) アミノ墓、N, N-ジ (エトキシエ チル) アミノ墓、N, N-ジ (n-プロポキシエチル) アミノ基、N、Nージ (イソプロポキシエチル) アミノ 基。N,N-ジ (n-ブトキシエチル) アミノ蟇。N, N-ジ (イソプトキシエチル) アミノ墓、N, N-ジ (tert-プトキシエチル)アミノ墓、N, N-ジ (n-ヘキシルオキシエチル) アミノ蟇、N,N-ジ (2-メトキンプロピル) アミノ基、N, N-ジ (メト キシイソプロビル) アミノ墓、N, N-ジ(2-エトキ シブロビル) アミノ基、N、N - ジ (エトキシイソプロ ピル) アミノ墓、N、N-ジ(2 - プロポキシブロビ ル) アミノ基、N、N-ジ (プロポキシイソプロビル) アミノ基、N. Nージ (メトキシエトキシエチル) アミ ノ蟇、N、N-ジ (エトキシエトキシエチル) アミノ 基、N-メチル-N-(メトキシエチル)アミノ基、N (プロピルオキシェチル)-N-エチルアミノ墓、N -ヘキシルオキンエチル-N-エチルアミノ基、N-(エトキシエトキシエチル) - N - エチルアミノ基、N - (シクロヘキシルオキシエチル) - N-エチルアミノ 基等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコ キン基で置換されたジアルキルアミノ基、

【()()47】N、Nージ (メチルチオメチル) アミノ 基、N、N-ジ (エチルチオメチル) アミノ基、N、N ージ (メチルチオエチル) アミノ基、N, Nージ (エチ ルチオエチル) アミノ基、N、N-ジ (n-プロビルチ オエチル) アミノ基、N、N-ジ (イソプロピルチオエ チル) アミノ基、N、N-ジ(n-プチルチオエチル) アミノ基、N、N – ジ (イソプチルチオエチル) アミノ 基.N,N-ジ(tert-プチルチオエチル)アミノ 基、N、N - ジ (n - ヘキシルチオエチル) アミノ基、 N、N-ジ(シクロヘキシルチオエチル)アミノ岳、 N、N-ジ(2-メチルチオプロピル)アミノ基、N, N-ジ (メチルチオイソプロピル) アミノ基、N、N-ジ(2-エチルチオプロビル)アミノ益、N.N-ジ (エチルチオイソプロピル)アミノ基、N, N-ジ(2 - プロピルチオプロピル) アミノ基、N、N - ジ(プロ ピルチオイソプロピル) アミノ基、N、N-ジ(メチル 50 ルイミド基、2-エチルヘキシルイミド基、エチルシク

チオエトキシエチル) アミノ基、N、N-ジ (エチルチ オエチルチオエチル) アミノ基等の炭素数1~10の直 鎖の分岐または環状のアルキルチオ基が置換したN、N ージアルキルチオアルキルアミノ基、N, Nージ(N-メチルアミノメチル〉アミノ基、N、N-ジ(N-メチ ルアミノエチル) アミノ墓、N、N-ジ(N-エチルア ミノメチル) アミノ基、N、N-ジ (N-エチルアミノ エチル) アミノ墓、N、N - ジ(N、N - ジメチルアミ ノメチル) アミノ基、N、N-ジ (N、N-ジエチルア 19 ミフメチル) アミン基、N. Nージ(N. Nージメチル アミノエチル) アミノ基、N、N-ジ (N, N-ジエチ ルアミノエチル)アミノ基等の炭素数1~10の直鎖、 分岐または環状のN、N-ジ(N-アルキルアミノアル キル) アミノ蟇、N、N - ジ (N、N - ジアルキルアミ ノアルキル) アミノ基等が挙げられる。

【①①48】置換又は無置換N-アリールアミノ蟇とし ては、例として、N-フェニルアミノ墓、N-トリルア ミノ墓、N-クロロフェニルアミノ墓、N-トリフルオ ロフェニルアミノ基、N-ナフチルアミノ基、N-メチ (ンクロヘキシルオキシエチル) アミノ基、N. Nージ 20 ルナフチルアミノ基、Nークロロナフチルアミノ基等が 挙げられる。置換又は無置換N, N-ジアリールアミノ 基の例としては、N. N-ジフェニルアミノ基、N. N ージトリルアミノ基、N、Nージクロロフェニルアミノ 基。N,N-ジトリフルオロフェニルアミノ基。N,N ージナフチルアミノ基、N、Nージメチルナフチルアミ ノ基、N、N-ジクロロナフチルアミノ基等が挙げられ る。置換又は無置換N-アルキル-N-アリールアミノ 基の例としては、N-メチル-N-フェニルアミノ基、 N-エチル-N-トリルアミノ基、N-メトキンエチル 30 - N - クロロフェニルアミノ基、N - エチル- N - トリ フルオロフェニルアミノ墓、N-シクロヘキシル-N-ナフチルアミノ基、N-エチル-N-ナフチルアミノ 基 N-2-エチルヘキシル-N-メチルナフチルアミ ノ墓、N-メチル-N-クロロナフチルアミノ墓等が挙 けられる。

> 【①049】また、一般式(7)においては、隣り合う 2個の基が一緒になり、N-アルキルイミド基、N-ア リールイミド基、芳香環、ヘテロ芳香環を形成してもよ い。その場合のN-アルキルイミド墓の例としては、メ 40 チルイミド基。エチルイミド基、n‐プロピルイミド 基.イソプロビルイミド蟇.n-ブチルイミド蟇.イソ ブチルイミド墓、Sec‐ブチルイミド基、n‐ベンチ ルイミド基、1-メチルプチルイミド基、2-メチルブ チルイミド基、3ーメチルプチルイミド基、1、1ージ メチルプチルイミド基、1、2-ジメチルプチルイミド 基、2、2-ジメチルプチルイミド基、1-エチルプロ ピルイミド基、2-エチルプロピルイミド基、n-ヘキ シルイミド基、シクロヘキシルイミド基、ガーヘブチル イミド苺、メチルシクロヘキシルイミド苺、n-オクチ

ロヘキシルイミド基、ジメチルシクロヘキシルイミド 基、n-ノニルイミド基、3、5、5-トリメチルヘキ シルイミド基。カーデシルイミド基等の炭素数1~10 の直鎖、分岐または環状のアルキルイミド基、メトキシ メチルイミド墓。エトキシメチルイミド基、メトキシエ チルイミド基。エトキシエチルイミド基、カープロポキ シエチルイミド苺、イソプロボキシエチルイミド苺、n - プトキシエチルイミド墓、イソプトキシエチルイミド 基. tert-プトキシエチルイミド芸、n-ヘキシル オキンエチルイミド基、シクロヘキシルオキシエチルイ 10 る。 ミド華、2-メトキシプロビルイミド華、メトキシイソ プロビルイミド基、2-エトキシプロビルイミド基、エ トキシイソプロビルイミド基、2-プロボキシプロピル イミド基、プロポキシイソプロピルイミド基等の炭素数 1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキシアルキル イミド基、

25

【0050】メチルチオメチルイミド蟇、エチルチオメ チルイミド基。メチルチオエチルイミド基、エチルチオ エチルイミド墓。nープロピルチオエチルイミド墓、イ ソプロピルチオエチルイミド基、カーブチルチオエチル 20 ル芸等のオキシカルボニルメチル基等が挙げられる。 イミド基、イソプチルチオエチルイミド基、teェt-ブチルチオエチルイミド墓、n-ヘキシルチオエチルイ ミド墓、シクロヘキシルチオエチルイミド基、2-メチ ルチオプロピルイミド基。メチルチオイソプロピルイミ ド蟇、2-エチルチオプロビルイミド蟇、エチルチオイ ソプロピルイミド基、2-プロピルチオプロピルイミド 基。プロピルチオイソプロビルイミド基、メチルチオエ トキシエチルイミド基、エチルチオエチルチオエチルイ ミド芸等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のア イミド基、N-メチルアミノエチルイミド基、N-エチ ルアミノメチルイミド基 N-エチルアミノエチルイミ ド墓、N,N‐ジメチルアミノメチルイミド基、N,N ージエチルアミノメチルイミド基、N、Nージメチルア ミノエチルイミド基、N、N-ジエチルアミノエチルイ ミド基等の炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のN - アルキルアミノアルキルイミド基、N. N - ジアルキ ルアミノアルキルイミド基等を挙げることができる。N ーアリールイミド基の例としては、N-フェニルイミド 甚、N-トリルイミド基、N-クロロフェニルイミド 基、N-トリフルオロフェニルイミド基、N-ナフチル イミド基、N-メチルナフチルイミド華、N-クロロナ フチルイミド基等が挙げられる。

【0.051】芳香環の例としては、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、アニリン、メチルアニリン、N-メチル アニリン、N、Nージメチルアニリン、エチルアニリ ン、N-エチルアニリン、フェノール、安息香酸、ニト ロベンゼン、エトロトルエン等のベンゼン環、ナフタレ ン、メチルナフタレン、エチルナフタレン、ニトロナフ

トラセン、メチルアントラセン、ニトロアントラセン等 のアントラセン環等が挙げられる。ヘテロ芳香環の例と しては、トリアジン、ピリジン、ピラジン、ピリミジ ン」ピラゾール」ピリダジン、ピロール、、キノリン、 イソキノリン、チアゾール、ベンゾチアゾール、オキサ ゾール、ベンゾオキサゾール、フェニキサジン、フェノ チアジン等の含窒素芳香環、フラン、ピラン、ベンゾフ ラン、キサンテン、クロメン、フェノキサチイン等の含 酸素芳香環、チオフェン等の含硫貴芳香環等が挙げられ

【0052】さらに、一般式(8)における活性メチレ ン墓の例としては、メチルカルポニルメチル基。エチル カルボニルメチル基等のアルキルカルボニルメチル基、 アミノカルボニルメチル蟇、メチルアミノカルボニルメ チル基、ジメチルアミノカルポニルメチル基、エチルア ミノカルボニルメチル基。ジエチルアミノカルボニルメ チル基、フェニルアミノカルボニルメチル基等のアミノ カルボニルメチル基、メトキシカルボニルメチル基、エ トキシカルボニルメチル蟇。フェノキシカルボニルメチ

【① 053】本発明の方法により、得られた超激粒子色 素分散液は、粒子径が200mm以下、好ましくは10 ① n m以下、更に好ましくは5 ① n m以下であり、極め て微細な粒子を有し、且つ返明性が高い。本発明の色素 **分散液は、インクジェットインク、水性インク、水性金** 料等に用いられる。イングジェットインクとは、パーソ ナルコンピューター、ワードプロセッサー等の出力機器 等として用いられるインクジェットプリンター用のイン クであり、水性インクとは 通常、紙等の被記録材料に ルキルチオアルキルイミド基、N-メチルアミノメチル 30 水性ペン等の記録具を用いて使用する記録用インクであ り、水性塗料とは、通常、紙、布、建材等の材料に膜状 に被覆させるものである。いずれの場合も、通常、色 素、水系溶填および添加剤等から成る。 本発明では、こ の色素、水系溶媒として、本発明の経微粒子色素分散液 を使用することを特徴とする。

> 【0054】本発明のインクジェットインクでは、色素 としては、通常、黒、費、マゼンタおよびシアンの4種 のインクを使用するが、遺度、精度、調色、組み合わせ 等により、これに限定されるものではない。インクジェ 40 ット記録方式において、多くは、インクを急激に加熱し 発生したパブルによりインクを吐出させるパブル方式。 営圧を印加すると変形するセラミックを用いてインクを 吐出させるピエゾ方式であり、いずれの方式でも使用す るととができる。 インクジェットインクは、インクとし てインクジェットプリンター内に装入して使用するが、 インクの稿充。メンテナンス等を容易にするため、通 「京」所定のインクカートリッジに充填して使用する。本 発明の色素分散液をインクジェットインクとして用いた 印刷画像は、極めて鮮明性に使れている。

タレン、ヒドロキシナフタレン等のナフタレン頃、アン 50 【0055】本発明の水性インクでは、通常、複数の色

(15)

意の組み合わせにより調色したインクを使用するが、単一の色素であっても構わない。水性インクは、インクの 舗充、メンテナンス等を容易にするため、通常、所定の インクカートリッジに充填して使用する。また、本発明 の水性塗料では、通常、複数の色素の組み合わせにより 調色したインクを使用するが、単一の色素であっても構 わない。刷毛、バーコーター、コテ、スプレー等の器具 を用いて塗付する。

27

[0056]

【東緒例】以下に、哀絶例をもって詳細に説明するが、 本発明は以下の例に限定されるものではない。

真餡例1(色素分散液の調製例1)

N、N・シメチルホルムアミド8、00重量部に、ボリビニルピロリドン【東京化成(株)製試薬、K・30】
2、00重量部はよび前記式(1)で表される色素【三 井化学(株)製品】0、27重量部を加え、80℃で機 持溶解させた。この温度を保ちながら、減圧条件下で、N、N・シメチルホルムアミドを図去して均一な色素含有樹脂2、26重量部を得た。この樹脂を乳鉢で粉砕し、粉末にした。室温にて、蒸図水5、0重量部をピー 20カーにはかりとり、マグネチックスターラーで開発しながら、この色素含有樹脂0、1重量部を徐々に加えていくと、均一で適明な標色分散液が得られた。この分散液中の分散粒子の平均粒径を光散乱型粒径分布計【大塚電子(株)製LPA-3100】で測定した結果、20mmであった。

【0057】実施例2(インク製造例1)

実施例1で作製した分散液を、ビエゾ式インクジェットフリンター(セイコーエブソン社製品MJ830C)のカートリッジに入れ、普通紙にべた打ちし、下記の方法 30で評価した。その結果、色むちもなく、鮮明な画像が得られた。また、被みもほとんど認められなかった。(評価方法】普通紙と光沢フィルム(セイコーエブソン(株)製)に、ビエゾ式インクジェットブリンターを用いて、同一の画像を印刷し、それぞれに印刷された画像を目視で比較した。両者がほぼ同じ色の場合を、鮮明な画像と認定した。

【①058】実施例3(色素分散液の調製例2) N、N-ジメチルホルムアミド8.00重量部に、ポリビニルピロリドン【東京化成(株)製試薬、K-30】 2.00重量部および式(2)で表される色素【三共化学(株)製品】①、27重量部を加え、80℃で概律を解させた。この温度を保ちながら、減圧条件下で、N、N-ジメチルホルムアミドを図去し、均一な色素含有樹脂2.26重量部を得た。これを乳鉢で粉砕し、粉末にした。窒温にて、蒸醤水5.0重量部を縦控しながら、この色素含有樹脂0.1重量部を徐々に加えていくと、均一で透明な赤紫色分散液が得られた。実施例1と同様に、この分散液の平均粒径を測定すると、7nmであった。 28

【0059】実施例4(インク製造例2) 実施例3で作製した分散液を、ピエゾ式インクジェット プリンター【セイコーエブソン社製品MJ830C】の カートリッジに入れ、普通紙にべた打ちした結果、鮮明

カードップに入れた、皆らはたいに行うした情報、 25万 な画像が得られた。 また、 滲みもほとんど認められなかった。

【0060】実施例5(芭素分散液の調製例3)

N、Nージメチルホルムアミド8.25宣登部に、ボリビニルピロリドン【東京化成(株)製試薬、K-30】2.01宣登部および式(3)で表される色素【三井化学(株)製品】0.27重量部を加え、80℃で捌拌溶解させた。この温度を保ちながら、減圧条件下で、N、Nージメチルホルムアミドを図去し、均一な色素含有樹脂2.33宣量部を得た。これを乳鉢で粉砕し、粉末にした。妄温にて、蒸図水5.0宣登部を縄拌しながら、この色素含有樹脂0.1重量部を徐々に加えていくと、均一で透明な遺青色分散液が得られた。実施例1と同様に、この分散液の平均粒径を測定すると、13nmであった。

25 【0061】実結例6(インク製造例3) 実結例5で作製した分散液を、インクジェットプリンタ

一機(セイコーエブソン社製品MJ830C)のカートリッジに入れ、普通低にべた打ちした結果、鮮明な画像が得られた。また、移みもほとんど認められなかった。【0062】実施例7(色素分散液の調製例4)ポリオキシエチレン高分子〔花王(株)製品、エマルゲン913】1.35宣置部に式(1)の色素〔三井化学(株)製品】0.15宣置部を加え、85~90℃で操控が割割では、均一な色素含育高分子1.50宣量部を保持に、結晶が析出しないよう。この温度を保って保管した。盆温にて、蒸留水方。0宣置部を接持しながら、この色素含有制脂0.1宣量部を徐々に加えていくと、均一で透明な提色分散液が得られた。実施例1と同様に、この分散液の平均粒径を測定すると、25ヵmであった。この分散液を、インクジェットブリンター機〔セイコーエブソン社製品MJ830C〕のカートリッジに入

【0063】実施例8(色素分散液の調製例5)

後みもほとんど認められなかった。

れ、普通紙に印刷すると鮮明な画像が得られた。また、

N、Nージメチルホルムアミド8.16宣母部に、ボリビニルピロリドン(東京化成(株)製試業、K-15)2.00宣母部および特開昭51-106125号公銀記載の方法により合成した下記式(9)(化6)で衰される色素0.27宣母部を加え、80℃で銀粋溶解させた。この温度を保ちながら、減圧条件下で、N、Nージメチルホルムアミドを図去すると、均一な色素含有樹脂2.25宣母部が得られた。これを乳鉢で粉砕し、粉末にした。窒温にて蒸図水5.0宣母部を銀枠しながら、この色素含有樹脂0.1重量部を徐々に加えていくと、

50 均一で透明な過青色分散液が得られた。実施例1と同様

(15)

特闘2000-26774

30

に、この分散液の平均粒径を測定すると、18nmであった。

29

[0064] [化6]

この分散液を水性ペン用のインクカートリッジに入れて 用いることにより、普通紙に、にじみがなく、鮮明な根 画が描くことができた。画像は、従来の水性ペンの場合 と比べ、水滴を落としても滲むことがなく、耐水性に優 れていた。また、この分散液をバーコーターでガラス板 上に塗付し、乾燥すると、透明な塗膜となった。

【0065】実施例9~12

第1表

* 実施例1 において、色素量、水溶性高分子、有機溶媒等の種類や畳を代えて、実施例1 と同様にして色素分散液を調製し、実施例2 と同様に評価した。調製条件、評価結果等をまとめて第1 表(表1、2)に示した。なお、評価の項の i j インクはインクジェットインクでの評価を意味する。また、表中の略号は、下記の意味を表す。

K = 15: ポリピニルピロリドンK = 15 K = 30: ポリピニルピロリドンK = 30 K = 90: ポリピニルピロリドンK = 90

19 E-913:エマルゲン913 PG-#400:ポリエチレングリコール#400

SC-400:レオコールSC400

PVA-203:ポリピニルアルコール203

DMF:ジメチルホルムアミド DMAc:ジメチルアセトアミド EG:エチレングリコール

EG-M:エチレングリコールモノメチルエーテル

【0066】 【表1】

实施例 1及び2 3及び4 5及以6 7 8 色索 種類 式(1) 式(2) 式(3) 式(1) 式 (9) 建量部 0. 27 0.27 0.27 0.15 0.27 水熔性 種類 K-30 E - 913 K-15 高分子 重量感 2 1.35 2 有機 翹類 DMP DMF 溶煤 重量概 8. 2 組類 **飛**水 水 建量部 75 113 113 分散温度(℃) 室温(25) 7 分散粒径 (nm) 20 13 25 18 0 0 **「**] インク 0 0 評価 水性インク 0 金膜 0

***2**9

[0067]

【表2】

(17)

特闘2000-26774

32

<u>31</u> 第1表 (つづき)

实施例		9	10	11	1 2
色衆	種類	式 (1) 0. 02	玩 (1) 10	式(1) 0.02	玩 (1) 0.01
水溶性		PG-#400 2	K-90 20	SC-400 2	PVA-203
有機	祖類	EG-M 100	DMA c 20	EG 100	<u>-</u>
水系溶媒	組織	水 198	10%-McOII/水 1 0	水 200	10%-DMP /水 200
分散過度(℃)		80	45	5	98
分散粒链(n m)		2 7	3 2	5 1	43
	【 ゴイン ク 水性インク 強膜	9	0	0	0

評価欄の「⑩」は、それぞれ下記の状態を示す。

・エナインク:色むら、にじみがなく、画像が鮮明

・水性インク:普通紙に にじみなく線が描ける

:透明で、にごりがない ・金膜

追試〉

[0068] 比較例(特開平8-188722号公銀の *記式(2)及び(3)の色素でも行ったが、同様であっ 30 tc.

水? () 重畳部を45℃で摂針しながら、ジメチルーβー シクロデキストリン8重量部を加え、溶解させた。次 に、前記式(1)の色素を加え繊維を続けたが、色素は 添加初期の状態のままで、溶解せず、色素が沈降してし まい、分散液は得られなかった。この液の平均位径は5 0000 n m以上であった。また孔径0. 2 u mのフィ

ルターで濾過すると、全てがフィルター上に残った。前米

[0069]

【発明の効果】本発明の超微粒子色素分散液は、極めて 透明性が高く、インクジェットイング、水栓イング、水 性塗料として有用である。更に、インクジェットイン り、水性インクとして用いたとき、鮮明な画像が形成す ることができる.

フロントページの続き

Fターム(参考) 4JG38 CE021 CKG31 DAG41 DF021

DF041 DH031 JA34 J816

JB18 KA08 MA08 NA01 PA06

PB11 PC10

43039 AD06 AD20 AE07 BC02 BC07

BC08 BC09 BC10 BC16 BC17

BC34 BC35 BC39 BC50 BC60

BEQ1 BEQ2 BE22 CAG6 EA33

EA41 EA42 GA24